(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-148395 (P2001-148395A)

(43)公開日 平成13年5月29日(2001.5.29)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	ァーマコート*(参考)
H01L 21/60		H 0 5 K 3/34	505A 5E319
H 0 5 K 3/34	505	H 0 1 L 21/92	604H
			604T

		番	木間氷 間氷頃の数24 〇L (全 18 貝)	
(21)出願番号	特願平11-328587	(71)出願人	000005108	
			株式会社日立製作所	
(22)出顧日	平成11年11月18日(1999.11.18)		東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地	
		(72)発明者	大録 範行	
			神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株	
			式会社日立製作所生產技術研究所内	
		(72)発明者	井上 康介	
			神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株	
			式会社日立製作所生産技術研究所内	
		(74)代理人	100068504	
			弁理士 小川 勝男 (外1名)	
			最終頁に続く	

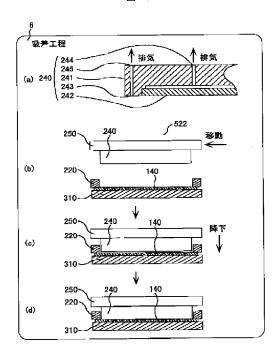
(54) 【発明の名称】 バンプ形成方法およびそのシステム

(57)【要約】

【課題】充分な体積を有し、かつ高さバラツキの少な く、しかも材料選定上の制約が少ない多数個のバンプを 半導体装置等の対象物に高速で、且つ高信頼度で、容易 に実現形成できるようにしたてバンプ形成方法およびそ のシステムを提供することにある。

【解決手段】本発明は、多孔質板242を用いた吸着へ ッド240と多数の開口部221aを有するステンシル 221を使用する。予めステンシル221内にはんだボ ール140を整列充填し、はんだボール140とステン シル221を吸着ヘッド240に吸着し、半導体装置1 00のパッド101面に対し位置決めした状態で、はん だボール140のみをパッド101上に落下せしめ、予 め塗布した粘着剤によりはんだボール140をパッド上 に固定し、その後リフローすることでバンプを形成す る。

図 8



【特許請求の範囲】

【請求項1】バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を整列ステージ上に載せ、供給された多数の導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列工程と、

該整列工程で整列された導電性粒子の群および該導電性 粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着装置に より吸着保持して前記整列ステージから離す吸着工程 レ

該吸着工程で吸着保持された導電性粒子の群および板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前記対象物とを相対的に位置合わせをする位置合わせ工程と、該位置合わせ工程で相対的に位置合わせされた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に移し替える移載工程と、

該移載工程で移し替えられた導電性粒子の群を対象物上 のパッドの群に接合させてバンプを形成する接合工程と を有することを特徴とするバンプ形成方法。

【請求項2】バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を整列ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納したスキージを前記板状の整列治具上を一方から他方へと並進させることによって導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列工程と、

該整列工程で整列された導電性粒子の群および該導電性 粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着装置に より吸着保持して前記整列ステージから離す吸着工程 と、

該吸着工程で吸着保持された導電性粒子の群および板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前記対象物とを相対的に位置合わせをする位置合わせ工程と、該位置合わせ工程で相対的に位置合わせされた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に移し替える移動工程と

該移載工程で移し替えられた導電性粒子の群を対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成する接合工程とを有することを特徴とするバンプ形成方法。

【請求項3】バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を整列ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージを前記板状の整列治具上を一方から他方へと並進させることによって導電性粒子を前記板状の整

列治具の開口部の群に順次充填しながら余分な導電性粒子を前記掻き落し部材で掻き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列工程と、

該整列工程で整列された導電性粒子の群および該導電性 粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着装置に より吸着保持して前記整列ステージから離す吸着工程 レ

該吸着工程で吸着保持された導電性粒子の群および板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前記対象物とを相対的に位置合わせをする位置合わせ工程と、該位置合わせ工程で相対的に位置合わせされた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に移し替える移載工程と、

該移載工程で移し替えられた導電性粒子の群を対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成する接合工程とを有することを特徴とするバンプ形成方法。

【請求項4】バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させることによって収納された導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列工程と、

該吸着工程で吸着保持された導電性粒子の群および板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前記対象物とを相対的に位置合わせをする位置合わせ工程と、該位置合わせ工程で相対的に位置合わせされた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に移し替える移載工程と、

該移載工程で移し替えられた導電性粒子の群を対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成する接合工程とを有することを特徴とするバンプ形成方法。

【請求項5】バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させることによって収納された導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填しながら、余分の導電性

粒子を前記掻き落し部材で掻き落して導電性粒子の群を 前記板状の整列治具に対して整列する整列工程と、

該整列工程で整列された導電性粒子の群および該導電性 粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着装置に より吸着保持して前記整列ステージから離す吸着工程 と、

該吸着工程で吸着保持された導電性粒子の群および板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前記対象物とを相対的に位置合わせをする位置合わせ工程と、該位置合わせ工程で相対的に位置合わせされた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に移し替える移載工程と、

該移載工程で移し替えられた導電性粒子の群を対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成する接合工程と を有することを特徴とするバンプ形成方法。

【請求項6】バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させることによって収納された導電性粒子の転がり運動に基いて該導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填しながら、余分の導電性粒子を前記掻き落し部材で掻き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列工程と、

該整列工程で整列された導電性粒子の群および該導電性 粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着装置に より吸着保持して前記整列ステージから離す吸着工程 レ

該吸着工程で吸着保持された導電性粒子の群および板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前記対象物とを相対的に位置合わせをする位置合わせ工程と、該位置合わせ工程で相対的に位置合わせされた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に移し替える移載工程と、

該移載工程で移し替えられた導電性粒子の群を対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成する接合工程とを有することを特徴とするバンプ形成方法。

【請求項7】更に、前記位置合わせ工程の前に、前記対象物上の少なくともパッドの群に対して粘着剤を供給する粘着剤供給工程を有することを特徴とする請求項1~6の何れかに記載のバンプ形成方法。

【請求項8】更に、前記整列工程の後、前記整列工程で 板状の整列治具の開口部の群に整列された導電性粒子の 群の状態を検査する検査工程を有することを特徴とする 請求項1~6の何れかに記載のバンプ形成方法。

【請求項9】更に、前記整列工程の後、前記整列工程で 板状の整列治具の開口部の群に整列された導電性粒子の 群の状態を検査する検査工程を有し、該検査工程で検査 された結果、抜けが許容数を越えて存在した場合には再 度前記整列工程を実行することを特徴とする請求項1~ 6の何れかに記載のバンプ形成方法。

【請求項10】更に、前記移載工程の後、前記移載工程 で対象物上のパッドの群に移し替えられた導電性粒子の 群の状態を検査する検査工程を有することを特徴とする 請求項1~6の何れかに記載のバンプ形成方法。

【請求項11】更に、前記移載工程の後、前記移載工程 で対象物上のパッドの群に移し替えられた導電性粒子の 群の状態を検査する検査工程と、

該検査工程で検査された結果、抜けが許容数を越えて存在した場合には抜けているパッド上に導電性粒子を選択的に搭載し、または過剰が許容数を越えて存在した場合には過剰な導電性粒子を選択的に除去する補修工程とを有することを特徴とする請求項1~6の何れかに記載のバンプ形成方法。

【請求項12】更に、前記接合工程の後、前記接合工程によってパッドにバンプが形成された対象物を所望の単位に切断する切断工程を有することを特徴とする請求項1~6の何れかに記載のバンプ形成方法。

【請求項13】バンプ形成位置に対応させて多数の開口 部の群を配列形成した板状の整列治具を整列ステージ上 に載せ、供給された多数の導電性粒子を前記板状の整列 治具の開口部の群に順次充填して導電性粒子の群を前記 板状の整列治具に対して整列する整列装置と、

該整列装置により整列された導電性粒子の群および該導電性粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着保持して前記整列ステージから離す吸着装置と、該吸着装置により吸着保持された導電性粒子の群および板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前記対象物とを相対的に位置合わせをし、該位置合わせされた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に移し替える移載制御装置とを備え、

該移載制御装置により移し替えられた導電性粒子の群を 対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成するよ うに構成することを特徴とするバンプ形成システム。

【請求項14】バンプ形成位置に対応させて多数の開口 部の群を配列形成した板状の整列治具を整列ステージ上 に載せ、多数の導電性粒子を収納したスキージを前記板 状の整列治具上を一方から他方へと並進させることによって導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順 次充填して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対し て整列する整列装置と、

該整列装置により整列された導電性粒子の群および該導 電性粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着保 持して前記整列ステージから離す吸着装置と、

該吸着装置により吸着保持された導電性粒子の群および 板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列 された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前 記対象物とを相対的に位置合わせをし、該位置合わせさ れた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記 導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解 放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群 に移し替える移載制御装置とを備え、

該移載制御装置により移し替えられた導電性粒子の群を対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成するように構成したことを特徴とするバンプ形成システム。

【請求項15】バンプ形成位置に対応させて多数の開口 部の群を配列形成した板状の整列治具を整列ステージ上 に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材 を有するスキージを前記板状の整列治具上を一方から他 方へと並進させることによって導電性粒子を前記板状の 整列治具の開口部の群に順次充填しながら余分な導電性 粒子を前記掻き落し部材で掻き落して導電性粒子の群を 前記板状の整列治具に対して整列する整列装置と、

該整列装置により整列された導電性粒子の群および該導 電性粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着保 持して前記整列ステージから離す吸着装置と、

該吸着装置により吸着保持された導電性粒子の群および 板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列 された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前 記対象物とを相対的に位置合わせをし、該位置合わせさ れた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記 導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解 放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群 に移し替える移載制御装置とを備え、

該移載制御装置により移し替えられた導電性粒子の群を 対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成するよ うに構成したことを特徴とするバンプ形成システム。

【請求項16】バンプ形成位置に対応させて多数の開口 部の群を配列形成した板状の整列治具を傾斜させた整列 ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻 き落し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列 治具上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進 させることによって収納された導電性粒子を前記板状の 整列治具の開口部の群に順次充填して導電性粒子の群を 前記板状の整列治具に対して整列する整列装置と、

該整列装置により整列された導電性粒子の群および該導 電性粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着保 持して前記整列ステージから離す吸着装置と、

該吸着装置により吸着保持された導電性粒子の群および 板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列 された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前 記対象物とを相対的に位置合わせをし、該位置合わせさ れた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記 導電性粒子の群についての吸着治具による吸着保持を解 放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群 に移し替える移載制御装置とを備え、

該移載制御装置により移し替えられた導電性粒子の群を 対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成するよ うに構成したことを特徴とするバンプ形成システム。

【請求項17】バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させることによって収納された導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填しながら、余分の導電性粒子を前記掻き落し部材で掻き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列装置と、

該整列装置により整列された導電性粒子の群および該導 電性粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着保 持して前記整列ステージから離す吸着装置と、

該吸着装置により吸着保持された導電性粒子の群および 板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列 された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前 記対象物とを相対的に位置合わせをし、該位置合わせさ れた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記 導電性粒子の群についての吸着治具による吸着保持を解 放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群 に移し替える移載制御装置とを備え、

該移載制御装置により移し替えられた導電性粒子の群を 対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成するよ うに構成したことを特徴とするバンプ形成システム。

【請求項18】バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させることによって収納された導電性粒子の転がり運動に基いて該導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填しながら、余分の導電性粒子を前記掻き落し部材で掻き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列装置と、

該整列装置により整列された導電性粒子の群および該導 電性粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着保 持して前記整列ステージから離す吸着装置と、

該吸着装置により吸着保持された導電性粒子の群および 板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列 された対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前 記対象物とを相対的に位置合わせをし、該位置合わせさ れた板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記 導電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に移し替える移載制御装置とを備え、

該移載制御装置により移し替えられた導電性粒子の群を 対象物上のパッドの群に接合させてバンプを形成するよ うに構成したことを特徴とするバンプ形成システム。

【請求項19】更に、前記整列装置により板状の整列治 具の開口部の群に整列された導電性粒子の群の状態を検 査する外観検査装置を備えたことを特徴とする請求項1 3~18の何れかに記載のバンプ形成システム。

【請求項20】更に、前記移載制御装置により対象物上のパッドの群に移し替えられた導電性粒子の群の状態を検査する外観検査装置を備えたことを特徴とする請求項13~18の何れかに記載のバンプ形成システム。

【請求項21】更に、前記移載制御装置により対象物上のパッドの群に移し替えられた導電性粒子の群の状態を検査する外観検査装置と、

該外観検査装置で検査された結果、抜けが許容数を越えて存在した場合には抜けているパッド上に導電性粒子を 選択的に搭載し、または過剰が許容数を越えて存在した 場合には過剰な導電性粒子を選択的に除去する補修装置 とを備えたことを特徴とする請求項13~18の何れか に記載のバンプ形成システム。

【請求項22】前記吸着装置は、真空吸着装置によって 構成することを特徴とする請求項13~18の何れかに 記載のバンプ形成システム。

【請求項23】前記吸着装置は、導電性粒子の群を吸着する部分に多孔質の基板を配置した真空吸着装置によって構成することを特徴とする請求項13~18の何れかに記載のバンプ形成システム。

【請求項24】前記整列装置において、掻き落し部材を、柔軟性を有する複数本のワイヤで構成することを特徴とする請求項15、17~18の何れかに記載のバンプ形成システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体装置等の対象物に対して電気的、機械的、熱的接続点となるバンプの形成方法およびそのシステムに関する。

[0002]

【従来の技術】半導体装置に対するバンプ形成方法については、既に数多く存在する。

【0003】例えばメッキ技術により半導体装置のパッド上に金属を析出させバンプを形成するメッキ法(従来技術1)、はんだペーストを半導体装置のパッド上に印刷した後、これを加熱することではんだペースト中のはんだの微粒子を溶融させ、後にこれがパッド上で固体化することでバンプを形成する印刷法(従来技術2)、金のワイヤの一端をパッド上に接続した後にこれを切断することでバンプを形成するスタッドバンプ法(従来技術

3)がある。更には、従来のはんだボールによるバンプを形成する方法として、第1には、米国特許第5284287号明細書および図面(従来技術4)で知られているように、はんだボールを真空吸引により治具に吸引した後にこれを半導体装置のパッド面上に搭載し、その後加熱してはんだボールを溶融させた後にこれを固体化させるものである。第2には、日本国特許第2897356号公報(従来技術5)に記載されているように、はんだボールを網板を用いて真空吸着し、これを半導体装置のパッド面上に搭載し、その後加熱してはんだボールを溶融させた後にこれを固体化させるものである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 来技術は、以下のような課題をそれぞれ有している。

【0005】一般にバンプの体積が大きいほど、半導体装置を電子回路基板上に接続した際の接続寿命を確保することが出来る。しかし、従来技術1、2のメッキ法や印刷法では、充分な体積を有するバンプを形成することが原理上難しい。更にバンプに高さバラツキが生じるため、半導体装置を電子回路基板上に接続する際に、すべてのバンプについて正常な接続を実現することが難しいというが存在する。一方、従来技術3のスタッドバンプ法には、ワイヤを製造できる材料が限定されるため、金など特定材質のバンプの形成にのみ適用することが出来るという問題が存在する。また、一個ずつバンプを形成するため、数万個のパッドを有する半導体装置に適用した場合、バンプ形成に多くの時間を費やしてしまうという課題が存在する。

【0006】また、従来技術4、5のはんだボール法では、バンプ高さのバラツキが少なく、かつ充分な体積を有するバンプを形成できるものの、構造が複雑でその製作に非常に微細な孔あけ加工技術が必要であるはんだボール真空吸着用の治具を使用する。この治具は、孔あけ数に比例して価格が高価になるため、バンプ数の多い半導体装置に対する場合は、バンプ形成コストが高くコスト面で課題がある。また網板を用いる場合ははんだボールに比して大きな直径を有する穴を加工するのみでよく、はんだボールの吸入の防止には網板を用いるため治具が簡便になる利点があるが、網板を用いるためにはんだボールの搭載位置が網線の上に来た場合、はんだボールの吸引位置がずれてしまうという課題があった。

【0007】本発明の目的は、上記従来技術の課題を解決すべく、充分な体積を有し、かつ高さバラツキの少なく、しかも材料選定上の制約が少ない多数個のバンプを半導体装置等の対象物に高速で、且つ高信頼度で、容易に実現形成できるようにしたてバンプ形成方法およびそのシステムを提供することにある。また、本発明の他の目的は、半導体装置等の対象物に多数個のバンプを一括形成するシステム構成を簡素化し、量産性に優れたバンプ形成を実現できるようにしたバンプ形成方法およびそ

のシステムを提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明はバンプ形成位置に対応させて多数の開口部 の群を配列形成した板状の整列治具を整列ステージ上に 載せ、供給された多数のはんだボール等の導電性粒子を 前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填して導電性 粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列工 程と、該整列工程で整列された導電性粒子の群および該 導電性粒子の群を整列させている板状の整列治具を吸着 装置により吸着保持して前記整列ステージから離す吸着 工程と、該吸着工程で吸着保持された導電性粒子の群お よび板状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が 配列された半導体装置等の対象物上に持ち来たし、前記 板状の整列治具と前記対象物とを相対的に位置合わせを する位置合わせ工程と、該位置合わせ工程で相対的に位 置合わせされた板状の整列治具と対象物とを接近させた 状態で前記導電性粒子の群についての吸着装置による吸 着保持を解放して前記導電性粒子の群を前記対象物上の パッドの群に移し替える移載工程と、該移載工程で移し 替えられた導電性粒子の群を対象物上のパッドの群に接 合させてバンプを形成する接合工程とを有することを特 徴とするバンプ形成方法である。

【0009】また、本発明は、前記整列工程を、バンプ 形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した 板状の整列治具を整列ステージ上に載せ、多数のはんだ ボール等の導電性粒子を収納したスキージを前記板状の 整列治具上を一方から他方へと並進させることによって 導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充 填して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整 列することを特徴とするバンプ形成方法である。また、 本発明は、前記整列工程を、バンプ形成位置に対応させ て多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を整 列ステージ上に載せ、多数のはんだボール等の導電性粒 子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージを前記 板状の整列治具上を一方から他方へと並進させることに よって導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に 順次充填しながら余分な導電性粒子を前記掻き落し部材 で掻き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対 して整列することを特徴とするバンプ形成方法である。 【0010】また、本発明は、前記整列工程を、バンプ 形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した 板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多 数のはんだボール等の導電性粒子を収納し、且つ掻き落 し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具 上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させ ることによって収納された導電性粒子を前記板状の整列 治具の開口部の群に順次充填して導電性粒子の群を前記 板状の整列治具に対して整列することを特徴とするバン プ形成方法である。また、本発明は、前記整列工程を、

バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多数のはんだボール等の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させることによって収納された導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填しながら、余分の導電性粒子を前記掻き落し部材で掻き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列することを特徴とするバンプ形成方法である。

【0011】また、本発明は、前記整列工程を、バンプ 形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した 板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多 数のはんだボール等の導電性粒子を収納し、且つ掻き落 し部材を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具 上を高い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させ ることによって収納された導電性粒子の転がり運動に基 いて該導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に 順次充填しながら、余分の導電性粒子を前記掻き落し部 材で掻き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に 対して整列することを特徴とするバンプ形成方法であ る。また、本発明は、前記バンプ形成方法において、更 に、前記位置合わせ工程の前に、前記半導体装置などの 対象物上の少なくともパッドの群に対して粘着剤を供給 する粘着剤供給工程を有することを特徴とする。また、 本発明は、前記バンプ形成方法において、更に、前記整 列工程の後、前記整列工程で板状の整列治具の開口部の 群に整列された導電性粒子の群の状態を検査する検査工 程を有することを特徴とする。また、本発明は、前記バ ンプ形成方法において、更に、前記整列工程の後、前記 整列工程で板状の整列治具の開口部の群に整列された導 電性粒子の群の状態を検査する検査工程を有し、該検査 工程で検査された結果、抜けが許容数を越えて存在した 場合には再度前記整列工程を実行することを特徴とす る。

【0012】また、本発明は、前記バンプ形成方法において、更に、前記移載工程の後、前記移載工程で対象物上のパッドの群に移し替えられた導電性粒子の群の状態を検査する検査工程を有することを特徴とする。また、本発明は、前記バンプ形成方法において、更に、前記移載工程の後、前記移載工程で対象物上のパッドの群に移し替えられた導電性粒子の群の状態を検査する検査工程と、該検査工程で検査された結果、抜けが許容数を越えて存在した場合には抜けているパッド上に導電性粒子を選択的に搭載し、または過剰が許容数を越えて存在した場合には過剰な導電性粒子を選択的に除去する補修工程とを有することを特徴とする。また、本発明は、前記バンプ形成方法において、更に、前記接合工程の後、前記接合工程によってパッドにバンプが形成された対象物を所望の単位に切断する切断工程を有することを特徴とす

る。

【0013】また、本発明は、バンプ形成位置に対応さ せて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具を 整列ステージ上に載せ、供給された多数の導電性粒子を 前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填して導電性 粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する整列装 置と、該整列装置により整列された導電性粒子の群およ び該導電性粒子の群を整列させている板状の整列治具を 吸着保持して前記整列ステージから離す吸着装置と、該 吸着装置により吸着保持された導電性粒子の群および板 状の整列治具を、バンプを形成するパッドの群が配列さ れた対象物上に持ち来たし、前記板状の整列治具と前記 対象物とを相対的に位置合わせをし、該位置合わせされ た板状の整列治具と対象物とを接近させた状態で前記導 電性粒子の群についての吸着装置による吸着保持を解放 して前記導電性粒子の群を前記対象物上のパッドの群に 移し替える移載制御装置とを備え、該移載制御装置によ り移し替えられた導電性粒子の群を対象物上のパッドの 群に接合させてバンプを形成するように構成することを 特徴とするバンプ形成システムである。

【0014】また、本発明は、前記整列装置を、バンプ 形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した 板状の整列治具を整列ステージ上に載せ、多数の導電性 粒子を収納したスキージを前記板状の整列治具上を一方 から他方へと並進させることによって導電性粒子を前記 板状の整列治具の開口部の群に順次充填して導電性粒子 の群を前記板状の整列治具に対して整列するように構成 したことを特徴とするバンプ形成システムである。ま た、本発明は、前記整列装置を、バンプ形成位置に対応 させて多数の開口部の群を配列形成した板状の整列治具 を整列ステージ上に載せ、多数の導電性粒子を収納し、 且つ掻き落し部材を有するスキージを前記板状の整列治 具上を一方から他方へと並進させることによって導電性 粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充填しな がら余分な導電性粒子を前記掻き落し部材で掻き落して 導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して整列する ように構成したことを特徴とするバンプ形成システムで ある。また、本発明は、前記整列装置を、バンプ形成位 置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した板状の 整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多数の導 電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するスキージ を前記傾斜した板状の整列治具上を高い方から低い方に 向かって傾斜に沿って並進させることによって収納され た導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次 充填して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して 整列するように構成したことを特徴とするバンプ形成シ ステムである。

【0015】また、本発明は、前記整列装置を、バンプ 形成位置に対応させて多数の開口部の群を配列形成した 板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上に載せ、多 数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材を有するス キージを前記傾斜した板状の整列治具上を高い方から低 い方に向かって傾斜に沿って並進させることによって収 納された導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群 に順次充填しながら、余分の導電性粒子を前記掻き落し 部材で掻き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具 に対して整列するように構成したことを特徴とするバン プ形成システムである。また、本発明は、前記整列装置 を、バンプ形成位置に対応させて多数の開口部の群を配 列形成した板状の整列治具を傾斜させた整列ステージ上 に載せ、多数の導電性粒子を収納し、且つ掻き落し部材 を有するスキージを前記傾斜した板状の整列治具上を高 い方から低い方に向かって傾斜に沿って並進させること によって収納された導電性粒子の転がり運動に基いて該 導電性粒子を前記板状の整列治具の開口部の群に順次充 填しながら、余分の導電性粒子を前記掻き落し部材で掻 き落して導電性粒子の群を前記板状の整列治具に対して 整列するように構成したことを特徴とするバンプ形成シ ステムである。

【0016】また、本発明は、前記バンプ形成システム において、更に、前記整列装置により板状の整列治具の 開口部の群に整列された導電性粒子の群の状態を検査す る外観検査装置を備えたことを特徴とする。また、本発 明は、前記バンプ形成システムにおいて、更に、前記移 載制御装置により対象物上のパッドの群に移し替えられ た導電性粒子の群の状態を検査する外観検査装置を備え たことを特徴とする。また、本発明は、前記バンプ形成 システムにおいて、更に、前記移載制御装置により対象 物上のパッドの群に移し替えられた導電性粒子の群の状 態を検査する外観検査装置と、該外観検査装置で検査さ れた結果、抜けが許容数を越えて存在した場合には抜け ているパッド上に導電性粒子を選択的に搭載し、または 過剰が許容数を越えて存在した場合には過剰な導電性粒 子を選択的に除去する補修装置とを備えたことを特徴と する。

【0017】また、本発明は、前記バンプ形成システムにおいて、前記吸着装置は、真空吸着装置によって構成することを特徴とする。また、本発明は、前記バンプ形成システムにおいて、前記吸着装置は、導電性粒子の群を吸着する部分に多孔質の基板を配置した真空吸着装置によって構成することを特徴とする。また、本発明は、前記バンプ形成システムにおける整列装置において、掻き落し部材を、複数本のワイヤで構成することを特徴とする。

【0018】以上説明したように、前記構成によれば、十分な体積を有し、かつ高さバラツキの少なく、材料選定上の制約が少ないはんだボールなどの導電性粒子を用いたバンプ形成を一括して行うようにして、高速化を実現し、しかも高信頼度で、容易にバンプ形成を可能にすることができる。また、前記構成によれば、半導体装置

等の対象物に多数個のバンプを一括形成する装置構成を 簡素化し、量産性に優れたバンプ形成を実現することが できる。

【0019】また、前記構成によれば、はんだボール等の導電性粒子の過不足を検査し、必要に応じリトライ動作および修正動作を行うことにより、より一層の信頼性を向上させることができる。

[0020]

【発明の実施の形態】本発明に係るバンプ形成方法およびそのシステムについて図面を用いて説明する。図1には、本発明に係るバンプ形成の基本的なフローを示す。図2には、本発明に係るバンプ形成システムの基本的構成を示す。即ち、本発明に係るバンプ形成の基本的なフローは、図1に示すように、投入工程1、粘着剤供給工程2、位置合わせ工程3、移載工程7、検査工程8、加熱工程9、洗浄工程13、検査工程14、および必要に応じて切断工程15からなる主たるフローと、特に本発明の特徴とする整列工程4、検査工程5、および吸着工程6からなる第1の副なるフローと、補修工程10、検査工程11、および再生工程12からなる第2の副なるフローとで構成される。

【0021】投入工程1は、バンプ形成システムに投入 する工程である。即ち、投入工程1は、図2に示すよう に、半導体装置等のバンプを形成する対象物100を収 納したカセットをローダ501に挿入し、更に対象物1 00をロードアーム等のロボット機構504によりロー **ダ**501に挿入されたカセットから取り出して位置合わ せ機構503に搭載し、位置合わせ機構503により対 象物100上に形成されたノッチ等の基準マークを基準 にして対象物100を位置合わせをし、この位置合わせ がなされた対象物100を例えばロボット機構504に よって搬送装置528上の微動ステージ280に搭載 し、該搬送装置528を搬送軌道505に沿って搬送し て粘着剤供給ステーションまで到達せしめる工程であ る。なお、投入工程1において投入される半導体装置等 の対象物100は、例えば図3に示すようにウェハのよ うにウェハ状態で供給される場合も、チップ状態に切り 離し、基板等に固定されて供給される場合もある。

【0022】粘着剤供給工程2は、図2に示すように、粘着剤供給ステーションに設けられた粘着剤供給装置520により、搬送装置528により粘着剤供給ステーションまで搬送される対象物100上のバンプ形成個所(パッド101)にフラックスやはんだペーストや導電性接着剤等の粘着剤120を供給する工程である。即ち、粘着剤供給工程2においては、図3に示すように、ウェハ等の対象物100は、搬送装置528上に設けられた微動ステージ280に真空吸着により固定されている。そして、粘着剤供給工程2において、開口部201aとパッド101とが対応する位置に位置付けされるように、開口部201aのあるステンシル201を枠20

2に張ったマスク200と対象物100とを相対的に位 置合わせをし、その後フラックス等の粘着剤120を開 口部201aを通して印刷等によって供給する。フラッ クス等の粘着剤120を印刷によって供給する場合に は、フラックス等の粘着剤120はゴム製のスキージ2 10によってステンシル201に刷り込まれ、対象物1 ○○上のパッド1○1に開口部201aを通して印刷供 給される。なお、使用する粘着剤の種類によっては、印 刷ではなくスタンプ転写方式や、全面塗布方式やディス ペンス方式を使用する場合もある。例えば粘着剤として 流動性が中程度のフラックスを使用する場合はスタンプ 転写を、流動性の極めて高いフラックスを使用する場合 はスピンコートなどの全面塗布を、はんだ粒子をフラッ クス成分と混和したはんだペーストの場合はスクリーン 印刷を、導電性接着剤を使用する場合はディスペンス方 式を用いることが好ましい。

【0023】次に、本発明の特徴とする第1の副なるフ ローの実施例について説明する。第1の副なるフローで ある整列工程4、検査工程5、および吸着工程6は、図 2に示す複数の整列・吸着ステーションに設けられた整 列装置522、外観検査装置320および吸着装置52 2において粘着剤供給工程2と並行して実行される。整 列装置522は、図4に示すように、15~30度程度 傾斜した傾斜整列ステージ310と、該傾斜整列ステー ジ310上に配置され、コの字型の枠222に、対象物 100のパッド101に相当する部分に開口部221a を形成したステンシル(型板)221を張った構造のボ ールマスク(ボール整列用治具)220と、上記し、長 方形形状の枠状部分230aの長手方向の両端間に、掻 き落し部材である複数本の柔軟性を有するワイヤ230 cを張り渡した構造のボールスキージ(図4(a)には 半割状態のボールスキージ230を示している。)23 Oとによって構成される。ステンシル(型板)221 は、対象物100上に配列されたパッド101の位置に 対応させてはんだボール140が整列される開口部22 1aを配列形成した薄板状体である。

【0024】特に、図4(b)(c)および図5に示すように、傾斜したボールスキージ230が、ボールマスク220上を高い側から低い側に向かって傾斜に沿って移動するため、ボールスキージ230内に供給された導電性粒子である粒子状のはんだボール140は、自重によって傾斜に沿って落下し(転がり)、下側の枠状部分の近傍に位置するものから順次ステンシル(型板)221に形成された開口部221aに挿入(充填)されていくことになる。そのため、下側の枠状部分の近傍からは、ワイヤ230cを無くして構成される。更に、最も上側のワイヤと上側の枠状部分との間の間隙は、はんだボールが入り込まないように形成されている。更に、ステンシル221の厚さは、余分のはんだボールをワイヤ230cによって掻き落し易いように、はんだボールの

直径よりわずか小さくしている。そして、ボールスキージ230における枠状部分230aの長手方向の両端における下面には、はんだボール140の直径の半分程度突出させた橇状部分230bを形成している。従って、橇状部分230bがステンシル221の表面に接触し、その間の枠状部分230aの下面は、ステンシル221の表面との間にはんだボール140の直径の半分程度の隙間が形成され、ステンシル221の開口部221aに挿入されたはんだボールと接触することはない。

【0025】以上説明したように、整列工程4では、多 数の導電性粒子である粒子状のはんだボール140が供 給されたボールスキージ230が、傾斜整列ステージ3 10と共に15~30度程度傾斜したボールマスク22 0のステンシル221上を傾斜に沿って高い方から低い 方へ向かって移動する。このとき、はんだボール140 が傾斜に沿って転がり落しながらステンシル221の開 口部221aに順次充填されて行き、図4(c)および 図5に示す如く、余分に付着したはんだボール140 a については、ワイヤ230cにより掻き落とされること になる。ワイヤ230cは、例えばタングステンの撚り 線からなる柔軟性(力が加わると引き伸ばされ、力が除 かれると元に戻る伸縮性を有する。)を有し、しかも余 分のはんだボール140aの真中より下の底の部分を押 すように力が作用するため、余分なはんだボール140 aに過大な力がかかるのを無くして持ち上げるような力 を作用させて、打痕・変形等のダメージを与えることが ない。このように、余分のはんだボール140aを、ボ ールスキージ230の移動方向と交叉する方向に張った 掻き落し部材である複数本のワイヤ230cで掻き落す ようにしたので、ステンシル221の表面からのワイヤ 230 cの高さ(はんだボールの半径以下)の設定が容 易となり、しかもボールスキージ230の移動方向に変 形しやすく余分なはんだボール140aに過大な力がか かるのを無くすることが可能となる。

【0026】最終的にボールスキージ230はボールマ スク220の枠222の開口部から抜けだし、それに伴 って使用されなかったはんだボール140は傾斜整列ス テージ310の外に押し出され、排出される。そして、 その後、傾斜整列ステージ310およびボールマスク2 20は、図4(d)に示すように水平状態に復帰する。 【0027】なお、開口部221aの直径は、整列工程 4で使用するはんだボール140の直径の1倍以上かつ 2倍未満(はんだボールが1個入り込み、2個は入り込 めない条件)である。しかし、開口部221aの直径を 2倍近くに大きくすると、その分はんだボール220の 位置決め精度が低下することになると共に、余分のはん だボール140aが開口部221aに入り込む量が大き くなってワイヤ230cで掻き落しずらくなる。例え ば、対象物100上のパッド101の大きさが0.2m m程度で、はんだボール140の直径が0.3mm程度 の場合、はんだボールの位置ずれ量として、0.1 mm 程度は許容することができる。従って、開口部221aの直径は、はんだボールの直径の1.1倍~1.5倍程度が好ましいことになる。また、ステンシル221における開口部221aは、ドリルなどによる機械的除去加工により加工可能であるほか、エッチングやアディティブ加工といった化学的な加工によっても加工することが可能であり、開口部221aの数などにより適切な加工方法を選択することで比較的安価にステンシル221を取得することが可能となり、その結果安価なボールマスク220を実現することが可能となる。

【0028】以上、余分なはんだボールを掻き落すのに 枠状部分230aの長手方向の両端の底部に張られた複 数本のワイヤ230cを用いた場合について説明した が、複数本のワイヤ230cに代わって該ワイヤ230 cと同様な剛性を有し、図6に示すような先端を高精度 に揃えたブラシやヘラ状のスキージ230 dでも良い。 特にブラシやヘラ状のスキージ230dの先端を揃える のは、開口部221a内に一旦入ったはんだボール14 Obを掃きださないようにするためである。また、ブラ シやヘラ状のスキージ230dを浅い角度ではんだボー ルの底部に入るようにしたのは、余分なはんだボールを 持ち上げるようにして掻き落すためである。基本的に は、多数の粒子状のはんだボール140が供給されたボ ールスキージ230を、ステンシル221上を傾斜に沿 って高い方から低い方へ向かって移動させることによっ て、はんだボール140を傾斜に沿って転がり落しなが らステンシル221の開口部221aに順次充填して行 き、掻き落し部材であるワイヤ230cやブラシやヘラ 状のスキージ230 dにより打痕・変形等のダメージを 与えることなく余分のはんだボール140aを掻き落す ことにある。

【0029】なお、以上説明した整列工程4では、多数 の導電性粒子である粒子状のはんだボール140が供給 されて収納されたボールスキージ230が、傾斜整列ス テージ310と共に15~30度程度傾斜したボールマ スク220のステンシル221上を傾斜に沿って高い方 から低い方へ向かって移動するようにして、多数のはん だボール140を傾斜に沿って転がしてボールマスク2 20に穿設された開口部221aに充填しやすくした が、ボールスキージ230に収納されるはんだボールの 数が少なくなったりした場合、掻き落し部材を工夫する ことによって、整列ステージ310やその上に載るボー ルマスク230を必ずしも傾ける必要はない。また、整 列ステージ310やボールマスク220等を傾斜させた 場合、ボールスキージ230に収納されるはんだボール の数が少ないために、余分なはんだボール140aが開 口部221aに充填されたはんだボールに引っ掛からな ければ、必ずしもワイヤ230cなどの掻き落し部材を 設ける必要はない。

【0030】次に、検査工程5において、外観検査装置 320を、図7(a)に示すように、ボールスキージ2 30を退去させた状態で整列装置522上に置き、この 外観検査装置320により整列工程4で充填されたはん だボールの有無を検査する。即ち、外観検査装置320 は、例えば暗視野照明する照明系(図示せず)と、はん だボールを含めたステンシル221からの散乱反射光に よる像を結像させるレンズ322、および該レンズ32 2で結像したはんだボールの像を撮像するCCDカメラ 321からなる検出光学系と、これら照明光学系および 検出光学系を移動させる移動機構323と、上記検出光 学系のCCDカメラ321から得られるはんだボールを 顕在化した画像を処理して全ての開口部221aに充填 されたはんだボールの有無を判定し、該判定に基いて図 7(b) に示すように、異常、合格、不合格の判断をす る画像処理部(図示せず)とで構成される。

【0031】このように検査工程5では、移動機構32 3によって照明光学系および検出光学系を2次元的に走 行することによって、CCDカメラ321からは開口部 221 aに充填されたはんだボール140について明る いリング状の画像として顕在化して検出され、はんだボ ールの有無が順次画像処理によって検査され、異常、不 合格、合格の判断が行われる。この結果、はんだボール 140の充填が合格ならば吸着工程6へ進み、不合格で あれば整列工程4に戻り、再度はんだボールの充填を行 う。はんだボールの欠損数が多い場合には、ボールスキ ージ230内にはんだボールを供給した状態で再度ボー ルスキージ230を走行させて行う。また、はんだボー ルの過剰数が多い場合には、空の状態で再度ボールスキ ージ230を走行させてワイヤ230cやブラシやヘラ 状のスキージ230 dによる掻き落しで行う。はんだボ ール140の充填状況が極端に悪い場合や、整列工程4 を繰り返しても合格にならない場合にはボールマスク2 20の汚れや、はんだボール140のサイズの異常など に起因するため、異常と見なしアラーム処理を行う。通 常はオペレータコールによる整列装置522のメンテナ ンス作業が実施される。なお、外観検査装置320の画 像処理部における各々の判断の境界値(許容ボール欠損 数、許容ボール過剰数、許容リトライ回数等)は、要求 歩留りや必要な生産タクト及び一括搭載はんだボール数 などに応じ適宜変更する。即ち、許容の限界は、バンプ 形成の品種に応じて設定される。

【0032】次に、吸着工程6において、外観検査装置320を退避させ、図8(b)(c)(d)に示すように、吸着装置522を持ち込んで、降下させることによって、ボールマスク220と充填されたはんだボール140とが吸着ヘッド240によって吸着される。吸着ヘッド240の構造は、図8(a)に断面で示すように、筐体241に多孔質板242を埋め込み、さらに多孔質板242の周辺にはマスク吸着穴243が複数設けて構

成される。更に、多孔質板242は多孔質板排気穴24 4を連通し、マスク吸着穴243はマスク排気穴245 を連通し、これら多孔質板242とマスク排気穴243 とは独立に吸着するしないを選択できるように構成され ている。多孔質板242は、様々な種類のボールマスク でも充填されたはんだボール140を一括吸着できるよ うに、例えば目の細かい多孔質セラミックで形成され る。そして、この多孔質セラミックの目の粗さは、はん だボール140を吸着したときにはんだボール140の 表面に傷を付けないように、しかも吸着位置にムラがな いように、はんだボール140の直径の1/5程度以下 にすることが望ましい。特に、ボールマスク220に充 填された多数のはんだボール140の群を多孔質板24 2によって吸着するため、ボールマスク220無しで は、吸着されたはんだボールの位置がずれる可能性があ る。そのため、吸着ヘッド240に、ボールマスク22 ○も一緒に吸着することによってはんだボールの位置ず れを防止することができる。

【0033】吸着ヘッド240は、図8に示すように、 ヘッド移動機構250によって傾斜整列ステージ310 の上方に移動し、ボールマスク220に填り込むように 降下する。この結果、多孔質板240は全ての整列済み のはんだボール140の群に対向することになる。ここ で、吸着ヘッド240を降下した際の吸着ヘッド240 の先端面とステンシル221の上面との間の間隙量は、 多孔質板242が、はんだボール140及びステンシル 221を押しつけないように、かつはんだボール140 が開口部221aから飛び出さないよう、はんだボール 140の直径の半分以下程度に制限することが望まし い。その後、多孔質排気穴244およびマスク排気穴2 45から真空排気が行われ、各々はんだボール140の 群、およびボールマスク220が吸着ヘッド240に吸 着される。ここで、多孔質板242背面の真空圧は、は んだボール140にダメージを与えないように、適度な 負圧(はんだボール径φ0.3mmの比較的やわらかい 錫鉛共晶はんだの場合、-1kPaから-10kPa程 度)に留めることが望ましい。当然、Sn-Ag-Bi 等のPbフリーはんだの場合、錫鉛共晶はんだよりも硬 くなるので、もう少し負圧を高めることができる。以上 により、第1の副なるフローである整列工程4、検査工 程5、および吸着工程6が実行されて、対象物100上 に形成された多数のパッド101の群に対応させて整列 された多数のはんだボール140の群を、ボールマスク 220と共に吸着ヘッド240に吸着した状態のものが 得られる。

【0034】次に、位置合わせ工程3において、図9 (a)に示すように、搬送軌道505上において粘着剤 供給ステーションから移載ステーションまで搬送装置5 28により搬送されて来た対象物100上のパッド10 1の群と、整列・吸着ステーションから上記移載ステー ションまで移動されてきた吸着装置522の吸着ヘッド240に吸着されたはんだボール140の群とを、相対的に位置合わせすることが行われる。即ち、ボールマスク220、およびはんだボール140は、吸着ヘッド240に吸着され、ヘッド移動装置250によって移載ステーションにおける対象物100の上に移動する。そこで、対象物100とボールマスク220との相対的位置ずれを、位置決め装置300によって測定する。この位置決め装置300としては、例えば図9(a)に示す如く、上下を同時に撮影できるプリズム303をレンズ301に搭載したCCDカメラ302と、該CCDカメラ302から得られる画像信号を処理して相対的位置ずれ量を測定する画像処理部とによって構成することができる。

【0035】次に、図9(b)(c)に示すように、測 定された相対的位置ずれ量に基いて、例えば対象物10 ○を搭載している微動ステージ280を面内方向に微動 制御して対象物100とボールマスク220との相対的 位置ずれを補正し、ヘッド移動装置250を垂直に降下 させることよって、最終的にはんだボール140の群が パッド101の群の直上に配置され、移載工程7に入る ことになる。移載工程7では、図10に示すように、は んだボール140の群のみを対象物100のパッド10 1の群上に載せる。即ち、マスク排気穴245の真空排 気は保持したまま、多孔質排気穴244を大気解放す る。すると、図10(a)に示す状態から図10(b) に示す状態へとはんだボール140のみがボールマスク 220の開口部221aより抜け出して、パッド101 の上に落下する。既にパッド101の上には粘着剤12 Oが供給されているため、はんだボール140は粘着剤 120の粘着力によりパッド101の上に安定する。こ の後、図10(c)に示すように、マスク排気穴245 の真空排気を保持したまま吸着ヘッド240を上昇さ せ、傾斜整列ステージ310が置かれた整列・吸着ステ ーションまで戻し、マスク排気穴245を大気解放すれ ば、ボールマスク220は当初の位置に復帰することに なる。なお、整列・吸着ステーションは、図2に示すよ うに複数設けられているので、位置合わせ工程3および 移載工程7は交互に行われることになる。

【0036】次に、検査工程8において、図11(a)に示すように、はんだボール140の搭載状況を検査する。図11(a)に示すように、外観検査装置320′を搬送装置528における対象物100の上方に移動させ、外観検査装置320′は、移載工程7で搭載されたはんだボール140の有無およびずれを検査し、画像処理部において図11(b)に示すように異常、合格、不合格を判断する。検査方法は、検査工程5と同様にしてもよい。但し、外観検査装置320′における照明系は、はんだボール140をパッドに対して顕在化するために、明視野照明によって構成してもよい。この判断結

果、はんだボール140の搭載が合格ならば、この合格の対象物100を搬送装置528によりアンローダの近傍まで搬送し、ロボット機構504によってアンローダ502内のカセットに収納する。そして、アンローダ502からカセットを取り出して加熱工程9に送られる。なお、合格の対象物100をアンローダ502を介さずに直接加熱炉まで搬送してもよい。

【0037】判断結果が、不合格の場合、不合格の対象物は搬送装置528により補修ステーションまで搬送されて補修機構340を用いて補修工程10が実行される。

【0038】なお、判断の結果、はんだボール140の 搭載状況が極端に悪い場合は、異常と見なし対象物100を搬送装置528によりアンローダの近傍まで搬送し、ロボット機構504によってアンローグ502内の異常カセットに収納すると共にアラーム処理を行う。そして、アンローグ502から異常カセットを取り出して再生工程12に送る。通常は、オペレータコールによる吸着装置522および位置決め装置300等のメンテナンス作業が実施される。なお、外観検査装置320°の画像処理部における各各々の判断の境界値(許容ボール欠損数、許容ボール過剰数、許容リトライ回数等)は、要求歩留りや必要な生産タクト及び一括搭載はんだボール数などに応じ適宜変更される。

【0039】次に、加熱工程9において、持ち込まれた 合格の対象物100を窒素リフロー炉に送り込み、加熱 することにより導電性粒子であるはんだボール140を 融解して粘着剤120のフラックスの働きでパッド10 1に接合し、図13に示すはんだバンプ160が形成さ れる。その後、フラックス残さの除去のため洗浄工程1 3をへて、バンプ外観検査を行う検査工程14を実施し た後、対象物100が例えばウェハの場合には図13に 示す切断工程15により、個々のバンプ付きチップ18 0に分離される。上記補修工程10では、図2に示す如 く、補修ステーションに設置された補修機構340を用 いてはんだボール140の搭載の補修をおこなう。補修 機構340は、図12に示すアーム341、これに付属 する真空ピンセット342、図2に示す真空ピンセット 先端の清掃を行う拭き取りパッド343、新規ボールト レイ345および不良ボール回収トレイ346から構成 される。補修工程10では、検査工程8の検査結果を用 い、余分な、または位置ずれしたのはんだボール140 を、順次真空ピンセット342によって除去する。この 除去したはんだボール140は不良ボール回収トレイ3 46に投入されて回収される。この間、真空ピンセット 342の先端は、常に拭き取りパッド343を用いて付 着した粘着剤120を拭き取り、清浄に保つ。この後、 新規ボールトレイ345から、新規のはんだボール14 ○を真空ピンセット342により順次補充する。このと きの補充位置は、先の検査工程8で搭載漏れが検出され たパッド101の上、およびずれが検出されてはんだボール140が除去されたパッド101の上である。

【0040】補修工程10の後、検査工程11を実施する。ここでも、外観検査装置320'を用いた画像処理検査が行われる。ここで、異常がなければ対象物100は加熱工程9に進むが、補修工程10を経たにも関わらず、はんだボール140が構異常が検出された場合には、この対象物100は再生工程12に回されると共に、オペレータコールを含む異常処理が実施される。再生工程12は、基本的に異常処理であるので、オペレータの介入の元に実施される。再生工程12では、フラックス等の粘着剤120を除去できる有機溶剤もしくは界面活性剤入りの洗浄水を用いた洗浄が行われ、はんだボール140は全て除去される。また、対象物100の異常がないか、粘着剤供給工程2や整列工程4などに異常が見られないか確認作業が実施される。

【0041】次に、本発明に係るバンプ形成システムの基本シーケンスを図14を用いて説明する。図2に示すように整列装置522は2組あるため、この整列工程4、検査工程5、吸着工程6の3工程を1組ずつ交互に実施される。一方、図2に示すバンプ形成システムの場合、搬送装置528が1組のため、ロード1aから、アンロード1bまでは一連の動作として実行される。このため、整列工程4に時間を掛けることができ、全体のタクトタイムの向上に役立てることが可能となる。

【0042】次に、吸着装置522における吸着ヘッド 240の具体的実施例について図15を用いて説明す る。図15には、対象物100がウェハの場合における 吸着ヘッド240のウェハ対向面を示す。筐体241の ほぼ中央に円形の多孔質板242が設けられており、そ の周辺に多数のマスク吸着穴243が配置されている。 このため、吸着ヘッド240は、ウェハ100のパッド 101の配置、即ちボールマスク220におけるステン シル221の開口部221aが変更されても、共用する ことができる。通常、チップ収量を高めるため、チップ シュリンクが頻繁に行われ、ウェハ等の半導体装置10 0内でのパッド101の配置も頻繁に変更されることが 想定されるが、本発明の実施の形態によれば、フラック スマスク200、およびボールマスク220を変更する のみで、パッド配置の変更に柔軟に対応することができ る。特にステンシル201やステンシル221などのス テンシルは、薄板にエッチングなどによる加工によって 大量の穴加工を一括して実施できるため、ドリル加工な どに比して安価であり、従来のボール搭載装置で真空吸 着ヘッドが高価であった欠点を解消している。

【0043】また、本発明の実施の形態では、ウェハ等の半導体装置である対象物100上のパッド数が数万個程度と数多くのでも、バンプ160を一括して上記対象物100上に形成することが可能となり、バンプ形成の量産性を飛躍的に向上させることが可能となる利点があ

る。なお、本発明によりバンプが形成可能な半導体装置には、ウェハ状態のもの以外に、ウェハを樹脂等で保護したもの、ウェハ状態から一部を切り出したもの、ウェハ状態から切り出した一部をパッケージングしたものなどさまざまでり、バンプ形成の対象をウェハ状態のものに限定するものではないことは当然である。例えば、図16に示す如く、複数の多孔質板242aを配列した吸着ヘッド240aを用いれば、中間基板100aに個片チップ180aを複数個搭載した半導体装置に一括してバンプ形成することが可能となる。当然、個片チップ180aに形成されたパッド(電極)の配置に合わせた開口部221aを形成したステンシル221を有するボールマスク220を用意する必要が有る。

【0044】ところで、図16には4チップ一括搭載の例を示したが、搭載チップ数は自由に変更することができる。この場合は、ウェハー括搭載に較べてチップ数や、チップ外形寸法の変更には制限が生じるが、従来のチップ対応のはんだボールマウンタ装置を用いる用途の代替えとして使用することができるメリットがある。また、図17に示すように単一の長方形の多孔質板242 bを設けた吸着ヘッド240bを用いることによって複数チップに対して一括搭載を行うことも当然可能である。このような場合は、小さなチップ180bを領域で一部を切り出し、モールドした後にはんだボールを搭載する用途にも使用できる。

【0045】以上説明した実施の形態では、吸着ヘッド 240を真空吸着するように構成したが、マグネット吸 着によって構成することもできる。しかし、電磁吸着の 場合、ボールマスク(ボール整列用治具)220および /または吸着ヘッド240に対して工夫する必要が有 る。即ち、吸着工程6においては、ボールマスク220 およびはんだボール(導電性粒子)140の群を吸着へ ッド240に吸着保持して傾斜整列ステージ310から 持ち上げる必要が有り、更に移載工程7においては、ボ ールマスク220を吸着ヘッド240に保持した状態で はんだボール(導電性粒子)140のみ半導体装置10 0のパッド101上に載せることができればよい。従っ て、ボールマスク220のステンシル221を電磁吸着 されない材料、例えば硬質の樹脂材もしくはセラミック 材等で形成し、ステンシル221を張る枠202を電磁 吸着する金属材料で形成し、吸着ヘッド240は該枠2 02を電磁吸着できるように構成すればよい。これによ り、移載工程7においては、はんだボール140の群に 対してのみ電磁吸着をOFFすることにより、ボールマ スク220を吸着ヘッド240に保持した状態で、はん だボール(導電性粒子)140のみ半導体装置100の パッド101上に載せることができることになる。

【0046】

【発明の効果】本発明によれば、充分な体積を有し、か つ高さバラツキの少なく、しかも材料選定上の制約が少 ない数多くのバンプを、一括して半導体装置等の対象物のパッド上に高速で、且つ高信頼度で、容易に形成することができる効果を奏する。また、本発明によれば、使用する治具類として安価なものが使用でき、しかもシステムとしても単純な構成にすることができるので、量産性に優れたバンプ形成を実現することができる効果を奏する。また、本発明によれば、はんだボールなどの導電性粒子をバンプ材料として使用できるため、様々な組成のバンプを形成するすることができる。また、本発明によれば、吸着装置の吸着ヘッドに多孔質板を用い、ボールマスクと共に使用することにより、バンプ位置の設計変更があっても柔軟に対応できる利点がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るバンプ形成の基本的なフローを示す図である。

【図2】本発明に係るバンプ形成システムの基本的構成 を示す平面図である。

【図3】本発明に係るバンプ形成フローのうち粘着剤供 給工程を説明するための図である。

【図4】本発明に係るバンプ形成フローのうち整列工程 を説明するための図である。

【図5】図4に示す整列工程において、掻き落し部材として複数本のワイヤを備えたボールスキージを用いてボールマスクの開口部にはんだボールを充填していく状態を示す断面図である。

【図6】図4に示す整列工程において、掻き落し部材としてブラシやヘラ状のスキージを備えたボールスキージを用いてボールマスクの開口部にはんだボールを充填していく状態を示す断面図である。

【図7】本発明に係るバンプ形成フローのうち整列工程 後の検査工程を説明するための図である。

【図8】本発明に係るバンプ形成フローのうち吸着工程 を説明するための図である。

【図9】本発明に係るバンプ形成フローのうち位置合わせ工程を説明するための図である。

【図10】本発明に係るバンプ形成フローのうち移載工程を説明するための図である。

【図11】本発明に係るバンプ形成フローのうち移載工程後の検査工程を説明するための図である。

【図12】本発明に係るバンプ形成フローのうち補修工

程を説明するための図である。

【図13】本発明に係るバンプ形成フローのうち切断工程を説明するための図である。

【図14】本発明に係るバンプ形成システムのタイムチャートを示す図である。

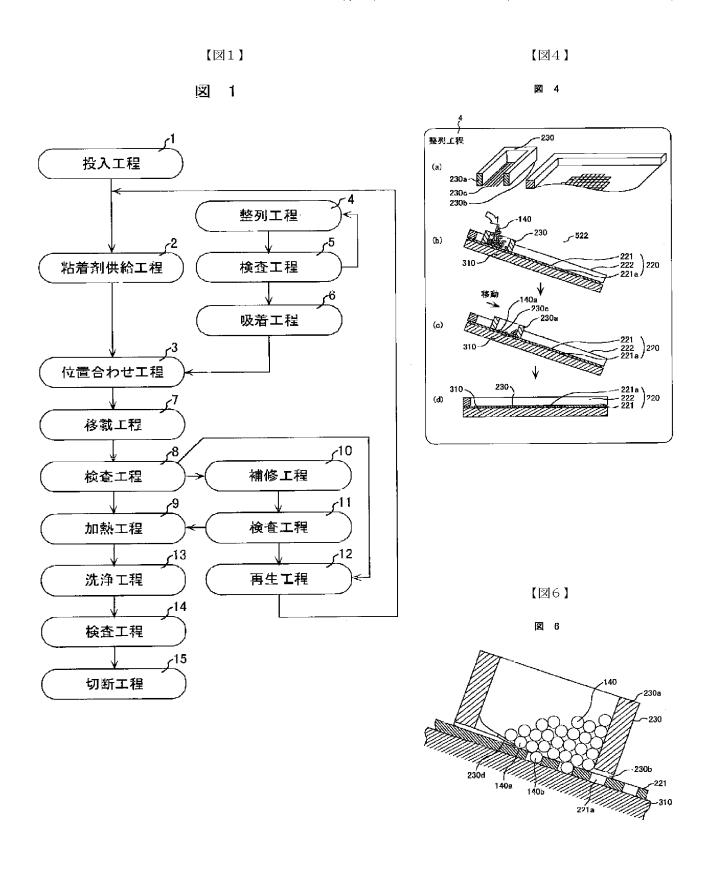
【図15】本発明に係る吸着ヘッドの一実施例を示す平面図である。

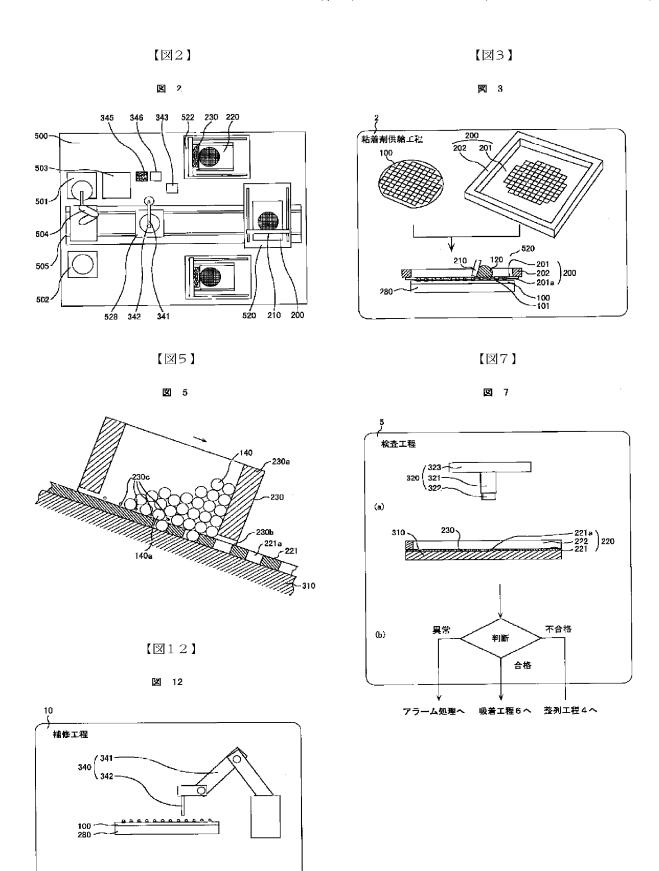
【図16】本発明に係る吸着ヘッドの変形例を示す平面 図および対象半導体装置を示す図である。

【図17】本発明に係る吸着ヘッドの別の変形例を示す 平面図および対象半導体装置を示す図である。

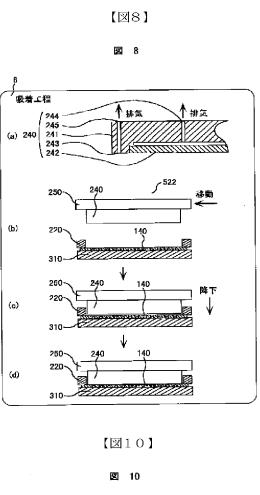
【符号の説明】

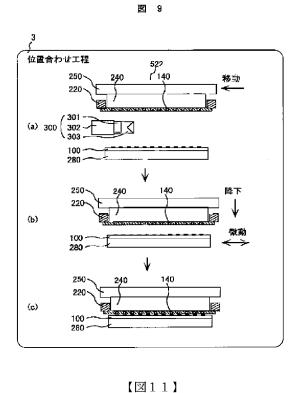
1…投入工程、2…粘着剤供給工程、3…位置合わせ工 程、4…整列工程、5…検査工程、6…吸着工程、7… 移載工程、8…検査工程、9…加熱工程、10…補修工 程、11…検査工程、12…再生工程、13…洗浄工 程、14…検査工程、15…切断工程、100…対象物 (ウェハ)、101…パッド、120…粘着剤、140 …はんだボール、160…バンプ、180…バンプ付き チップ、200…マスク、201…ステンシル、201 a…開口部、202…枠、210…スキージ、220… ボールマスク、221…ステンシル、221a…開口 部、222···枠、230···ボールスキージ、230a··· 枠状部分、230b…橇状部分、230c…ワイヤ(掻 き落し部材)、230d…ブラシやヘラ状のスキージ (掻き落し部材)、240…吸着ヘッド、241…筐 体、242…多孔質板、243…マスク吸着穴、250 …ヘッド移動装置、280…微動ステージ、300…位 置決め装置、301…CCDカメラ、302…レンズ、 303…プリズム、310…傾斜整列ステージ、32 0、320'…外観検査装置、321…CCDカメラ、 322…レンズ、323…移動機構、340…補修機 構、341…アーム、342…真空ピンセット、343 …拭き取りパッド、345…新規ボールトレイ、346 …不良ボール回収トレイ、500…装置筐体、501… ローダ、502…アンローダ、503…ノッチ合わせ機 構、504…ロボット機構、505…搬送軌道、520 …粘着剤供給装置、522…整列装置、524…吸着装 置、528…搬送装置。

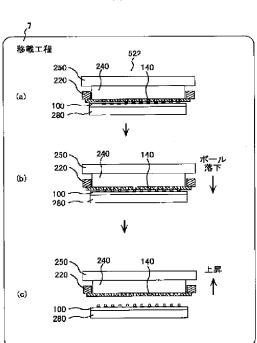


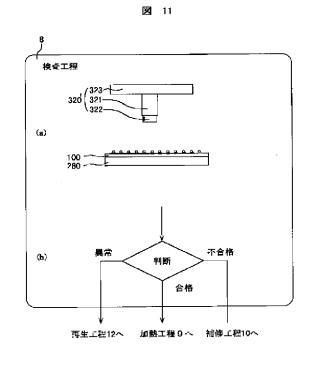


【図9】



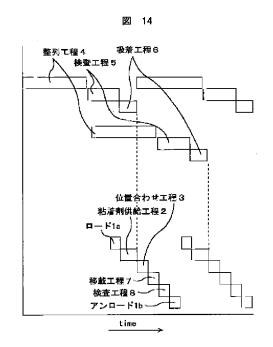


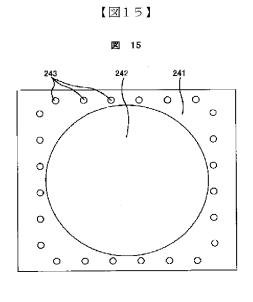


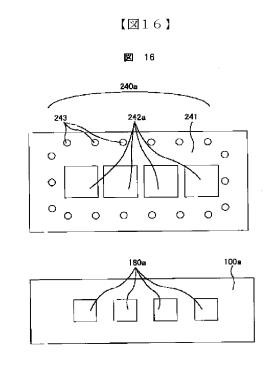


【図14】

15 切斯工程 100 切断

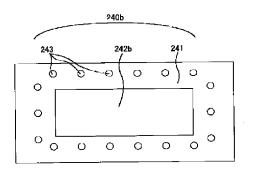


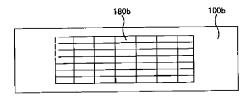




【図17】

図 17





フロントページの続き

(72)発明者 鈴木 高道

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作所生産技術研究所内

(72)発明者 西村 朝雄

東京都小平市上水本町五丁目20番1号 株 式会社日立製作所半導体グループ内 Fターム(参考) 5E319 BB04 CD21 CD25 CD53 GG15